

高功率激光与光学

均匀软X射线多层膜制备方法研究

金春水 林强 马月英 裴舒 曹健林

(中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春130022)

摘要: 介绍了基于速度调制技术的均匀软X射线多层膜制备方法, 并采用该方法在直径为150mm的平面硅基板上制备出Mo/Si多层膜, 其中心波长为13.5nm, 膜厚空间非均匀性优于1%, 较转盘匀速溅射方法制备的多层膜膜厚空间均匀性提高了近6倍。

关键词: [软X射线](#) [多层膜](#) [磁控溅射](#) [均匀性](#)

通信作者:

相关文章([软X射线](#)):

[类钠铜离子软X射线激光三体复合泵浦机制的研究](#)

[一种长狭缝软X射线扫描相机系统](#)

[HIREFS谱仪在类氩钛软X射线激光中的应用](#)

[高通滤波法数字重现同轴全息图](#)

[可变入射距离平焦场谱仪的概念设计](#)

[\[PDF全文\]](#)

[\[HTML摘要\]](#)

[发表评论](#)

[查看评论](#)